

期刊信息

篇名	Ni/Pd/Si固相反应及NiSi热稳定性增强研究
语种	中文
撰写或编译	
作者	屈新萍,茹国平,李炳宗等
第一作者单位	
刊物名称	半导体学报,
页面	23(11), 1173-1177 (2002).
出版日期	2002年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	多层薄膜固相反应与Co-Ni系硅化物薄膜外延及应用研究